

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成27年11月5日(2015.11.5)

【公表番号】特表2015-517020(P2015-517020A)

【公表日】平成27年6月18日(2015.6.18)

【年通号数】公開・登録公報2015-039

【出願番号】特願2014-555733(P2014-555733)

【国際特許分類】

C 23 C 14/32 (2006.01)

C 23 C 14/48 (2006.01)

H 01 J 37/317 (2006.01)

【F I】

C 23 C 14/32 F

C 23 C 14/48 A

H 01 J 37/317 E

【手続補正書】

【提出日】平成27年9月9日(2015.9.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

層を形成する方法であって、前記方法は、

その上への堆積に適合化された少なくとも1つの表面を有する基板を供給することと、

基板の表面に向かって粒子ビームを送ることとを含み、前記粒子ビームは、適度に荷電

したイオン(MCI)を含み、実質的にすべての前記MCIは、±2～±6の電荷と約2

00eV以下の運動エネルギーとを個別に有し、

前記MCIは、約30eVを超えて基板の表面内に侵入せず、基板上に層を形成する、方法。

【請求項2】

実質的にすべての前記MCIは、約5eVと200eVとの間の運動エネルギーを有する、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

実質的にすべての前記MCIは、±3～±6の電荷を有する、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記粒子ビームの供給源は、多重荷電イオンを生成するように構成される、請求項1に記載の方法。

【請求項5】

前記粒子ビームは、少なくとも加速減速ビーム輸送技術を用いて表面に向けて送られる、請求項1に記載の方法。